

# PICOSUN™ R-200 STANDARD

PICOSUN™ R-200 Standard ALDシステムは、ICコンポーネント、MEMSデバイス、ディスプレイ、LED、レーザーといったエレクトロニクス関連、及びレンズ、光学系、宝石、コイン、医療用インプラント等の3D形状物など、多数のアプリケーションのR&Dに適しています。



PICOSUN™ R-200 Standard ALDシステムは、サーマルALD用R&D装置のマーケットリーダーであり、イノベーションを目指す企業や研究機関に最適なツールです。

アジャイルな設計により、最高品質のALD成膜と、将来的なニーズやアプリケーションにも適合できる非常に柔軟性の高いシステムが可能になっています。それぞれ完全に分離されたプリカーサ注入口及び計装器類を備えた特許取得済みのホットウォール設計によりパーティクルフリーの処理が可能になり、ウエハ、3D形状物、及びナノスケール形状の幅広い材料に適用できます。当社独自の Picoflow™テクノロジーにより、多孔質、超高アスペクト比、ナノ粒子など非常に困難なサンプル上においても優れた均一性が実現できます。PICOSUN™ R-200 Standard システムには、液体、気体、および固体原料用の高機能で交換が容易なプリカーサソースが装備されています。グローブボックス、粉体成膜ユニット、および種々のin-situ分析システムとの統合により、現在の、また将来の研究分野が何であれ、効率的で柔軟な研究が可能になり、優れた結果を得ることができます。

## 技術的特長

### 標準的な基板サイズと種類

- 50-200 mm 枚葉ウエハ
- 156 mm x 156 mm ソーラー-Siウエハ
- 3D形状物
- 粉末および微粒子
- ミニバッチ
- 多孔質、貫通孔、高アスペクト比 (1:2500~)

### 処理温度

- 50~500°C

### 標準プロセス

- $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Ta}_2\text{O}_5$ 、 $\text{HfO}_2$ 、 $\text{ZnO}$ 、 $\text{ZrO}_2$ 、 $\text{TiN}$ 、 $\text{AlN}$ 、 $\text{Pt}$ や $\text{Ir}$ などのメタル

### 基板ローディング

- 空気圧リフトによるマニュアルローディング
- マグネティックマニピュレータームによるロードロック

### プリカーサ

- 液体、固体、気体、オゾン
- 4か所に分かれた注入口から最大6種のソース

### オプション

- Picoflow™ ディフュージョンエンハンサ、RGA、 $\text{N}_2$ ジェネレータ、除害装置、カスタマイズデザイン、不活性環境ローディング対応グローブボックス

最高品質のALDシステムを、  
要求の厳しいアプリケーションへ

詳細な情報をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

**picosun**  
AGILE ALD